

Gravure du nitrure											
1-U _i	0,2-0,8	0,2-0,7	0,2-0,7	0,02-0,3	S. O.	0,1-0,3	0,1-0,4	0,1-0,4	0,05-0,2	0,05-0,3	S. O.
P _{CF4}	S. O.	0,05-0,5	0,01-0,8	0,05-0,1	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,4	0,02-0,4	S. O.
P _{C2F6}	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,3	0,02-0,3	S. O.				
P _{C3F8}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.						
Gravure du silicium											
1-U _i	0,2-0,8	0,2-0,7	0,2-0,7	0,02-0,3	S. O.	0,1-0,3	0,1-0,4	0,1-0,4	0,05-0,2	0,05-0,3	S. O.
P _{CF4}	S. O.	0,05-0,5	0,01-0,8	0,05-0,1	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,4	0,02-0,4	S. O.
P _{C2F6}	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,3	0,02-0,3	S. O.				
P _{C3F8}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.						
Gravure du métal											
1-U _i	0,2-0,8	0,2-0,7	0,2-0,7	0,02-0,3	S. O.	0,1-0,3	0,1-0,4	0,1-0,4	0,05-0,2	0,05-0,3	S. O.
P _{CF4}	S. O.	0,05-0,5	0,01-0,8	0,05-0,1	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,4	0,02-0,4	S. O.
P _{C2F6}	S. O.	0,01-0,3	S. O.	S. O.	0,02-0,3	0,02-0,3	S. O.				
P _{C3F8}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.						
NETTOYAGE DES CHAMBRES											
Nettoyage de Système au plasma interne											
1-U _i	0,8-0,95	0,4-0,8	S. O.	S. O.	0,2-0,6	0,05-0,3	0,05-0,3	S. O.	S. O.	0,05-0,2	0,05-0,2
P _{CF4}	S. O.	0,05-0,2	S. O.	S. O.	0,05-0,2	0,05-0,2	0,05-0,2	S. O.	S. O.	0,05-0,2	0,05-0,2
P _{C2F6}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.						
P _{C3F8}	S. O.	S. O.	S. O.	0,02-0,08	S. O.						

